软 X 射线位相型金透射光栅的设计与制作*

邱克强 徐向东* 刘 颖 洪义麟 付绍军*

(中国科学技术大学国家同步辐射实验室,合肥 230029) (2008年3月1日收到 2008年4月18日收到修改稿)

根据衍射光栅的标量理论,计算并讨论了金透射光栅在软 X 波段衍射效率对光栅厚度和占宽比的依赖关系. 结果表明,选择合适的光栅槽深和占宽比,高达 21.9%的衍射效率可能被获得,远高于振幅型光栅的 + 1 级衍射效 率 10.14%.通过全息光刻与电镀转移技术制作的位相型金透射光栅由 300 nm 的聚酰亚胺薄膜支撑,光栅槽深 200 nm,占宽比为 0.55,周期为 1 μ m,面积为 20 mm × 5 mm.在国家同步辐射装置上,测得其 + 1 级透射衍射效率在波 长 λ = 7.425 nm 时获得最大值 约为 16%.

关键词:透射位相光栅,全息光刻,电镀 PACC:4240E,4280F,0765

1.引 言

作为软 X 射线波段重要的色散元件,金透射光 栅,尤其亚微米周期的金透射光栅近年来发展迅速, 其制作工艺及相关技术也日趋成熟^[1-6].因为能获 得比振幅型黑白光栅高得多的衍射效率,位相型金 透射光栅完全可以代替振幅型光栅应用于微小位移 测量系统中的成像^[7].非线性光学处理^[8],以及激光 惯性约束核聚变^[9-11]与 X 射线天体物理学^[1,12,13]等 领域的 X 射线能谱分辨.

在大多数应用中,高衍射效率是光学元件设计 和制作的目标之一.光栅的标量理论表明,传统的振 幅型透射光栅的+1级衍射效率最高仅为10.14%. 然而,随着入射光光子能量的增加,一定厚度的光栅 线条将不再能完全阻挡入射光的通过,而变得部分 透明,透过光栅线条的入射光由于相位的变化将与 从光栅缝隙透过的入射光干涉叠加.因此,可以通过 改变光栅厚度来改变干涉叠加后的衍射光效率.对 于某一固定的使用波长,只要选择合适的光栅厚度, 就完全可能使从光栅缝隙透过的入射光干涉削弱0 级透射光,从而提高其他级次的衍射效率.

对金透射光栅的衍射效率的实验标定和数值模

拟结果^[14]表明,根据衍射光栅的标量理论,计算周 期远大于使用波长的透射光栅效率是完全可靠的. 本文计算了位相型金透射光栅的1级衍射效率随光 栅厚度和占宽比的变化.设计制作出了厚度 200 nm, 占宽比约为 0.55,周期 1 μm 的透射光栅,光栅线条 由 300 nm 的聚酰亚胺支撑,光栅面积 20 mm × 5 mm. 在同步辐射的软 X 波段,光栅的衍射效率被测量, 结果表明 + 1 级衍射效率大约为 16%.

2. 位相型透射光栅效率计算

本文设计和制作的透射光栅使用于软 X 射线 波段(由于测量条件限制,选择 5—12 nm 波段),因 为使用波长远小于光栅周期(1 μ m),所以可以用标 量衍射理论来模拟计算光栅的衍射效率.位相型透 射光栅的衍射效率除了受光栅槽形,槽深和占宽比 (线宽/周期)的制约之外,还将受到光栅材料的影响. 光栅材料对入射光的吸收特性将直接影响到透过线 条部分的光线的位相改变,进而影响衍射效率,本文 选择金来制作光栅.根据夫琅禾费衍射理论^[15],用平 行光源照明时,由不透明屏上的 N 条等距矩形长狭 缝组成的振幅型透射光栅 缝宽 s 线宽 a 周期 d = s+ a ,平行于光栅平面的屏上 P 处光强为

^{*}国家自然科学基金(批准号 50375149,10776030)资助的课题.

[†] 通迅联系人. E-mail:xxd@ustc.edu.cn

非 通迅联系人. E-mail:sjfu@ustc.edu.cn

)

$$I_{(p)}^{amp} = I_0 \left(\frac{\sin \frac{Nkdp}{2}}{\sin \frac{kdp}{2}} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{ksp}{2}}{\frac{ksp}{2}} \right)^2 , \quad (1)$$

其中波矢量 $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$, $p = \sin\theta$.

对于位相型金透射光栅,光栅线条对入射光不 再完全不透明,受到金的吸收和位相调制之后,透过 光栅线条的入射光将与直接从狭缝穿过的0级光干 涉叠加(如图1).金的折射率 $n = (1 - \delta) - i\beta$,考虑 金光栅线条的位相与吸收作用,位相光栅在 P处的 衍射强度^[16]变为

$$I_{(p)}^{pha} = I_0 \left(\frac{\sin \frac{Nkdp}{2}}{\sin \frac{kdp}{2}} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{ksp}{2}}{\frac{ksp}{2}} \right)^2 \times \left[1 + e^{-2k\beta} - 2e^{-k\beta} \cos(kt\delta) \right].$$
(2)



图 1 通过光栅线条(A)与光栅狭缝(B)的入射光在 p 点干涉叠加

因此 第 $m(m \neq 0)$ 级的衍射效率为

$$\gamma_m = \left[\frac{\sin(Nm\pi)}{N\sin(m\pi)}\right]^2 \left[\frac{\sin(sm\pi/d)}{m\pi}\right]^2$$

× $[1 + e^{-2k\beta t} - 2e^{-k\beta t} \cos(kt\delta)].$ (3)

式中第一个中括号里是多缝干涉因子,对整数 m 取极大值 1.第三个括号里是分别从光栅狭缝和光栅 线条透过的入射光相互干涉叠加项.假设 $\beta = 0$,第 三个括号里等于 2[1 - cos(kt)],反映了光栅线条 对入射光的位相调制作用;假设 $\delta = 0$,第三个括号 里的表达式变为(1 - e^{ka}),反映了光栅线条的对入 射光的吸收作用;第二个括号里是单缝衍射因子,如 果 s/d = 0.5,当 m 取偶数时为零,因此偶数级次将 完全消失;当 m 为奇数时取最大值,此时第 m 级效 率^[16]为

$$\eta_m = \left[\frac{1}{m\pi}\right]^2 \left[1 + e^{-2k\beta t} - 2e^{-k\beta t} \cos(kt\delta)\right], \quad (4)$$

$$\eta_0 = \frac{1}{4} \left[1 + e^{-2kx} + 2e^{-kx} \cos(kt\delta) \right].$$
 (5)

从(4)和(5)式可以看出,如果 cos($kt\partial$)为负,零级透 射衍射效率将干涉减弱,同时加强奇整数级效率.因此,通过选择合适的槽深t和入射光波波长 λ ,光栅 的1级透射衍射光可以获得最优化的衍射效率.图 2是槽深200 nm,占宽比0.5的金透射光栅衍射效率 随波长的变化.可以看出,随着入射光能量的增加, 波长小于9 nm 以后,光栅线条变得部分透明,位相 作用越来越明显,在7.4 nm 处1级衍射效率将获得 极大值17%.图3是相同的槽深,不同的占宽比时, 光栅的1级衍射效率随波长的变化,结果再现了当 占宽比a/d = 0.5时,1级衍射效率将取得最大值的 预言.



图 2 槽深为 200 nm ,占宽比为 0.5 的金透射位相光栅



图 3 槽深为 200 nm 不同占宽比的金透射位相光栅的 1 级衍射 效率分布

从图 4 可以发现,在光栅槽深从 60 nm 增至 300 nm过程中,需要增加入射光光子能量才能穿透 光栅线条,所以获得最高效率处的波长将向短波方 向移动.槽深 100 nm 的透射光栅在波长 λ = 9.1 nm 的入射光照明时衍射效率取得最大值 21.9%.在实际过程中,可以根据使用波长,在制作条件允许的情况下选择并精确控制槽深和占宽比以获得尽可能高的1级衍射效率.需要说明的是,计算模拟中没有考虑支撑膜层和用于电镀的导电层对入射光波的吸收.



图 4 占宽比 0.5 不同槽深的金透射位相光栅 1 级衍射效率分布

3. 位相型金透射光栅的制作

透射光栅的制作主要包括光刻胶掩模制备和图 形转移技术.目前,在亚微米周期光栅制作过程中, 全息光刻^[17]和电子束光刻^[18]是制备光刻胶掩模的 主要技术.掩模图形的转移则可以通过离子束刻 蚀^[3-6]蒸发-剥离(lift-off),微电镀沉积等技术来实 现.本文采用全息-微电镀方法来制作位相型金透射 光栅.其制作工艺流程如图 5 所示.在清洁后的玻璃 基片上依次制备 300 nm 厚的聚酰亚胺,10 nm 左右 的金电镀层,和 400 nm 厚的光刻胶层.用氦镉激光 (442 nm)的双光束干涉光路对光刻胶曝光,经显影



图 5 金透射光栅的制作工艺流程

后形成光刻胶浮雕光栅图形.采用中性的亚硫酸盐 电镀液电镀沉积金,选择适当的电流密度与温度,并 保证电解液的温度均匀性以获得光滑致密的金光栅 线条.当金沉积到预期厚度后结束电镀,去掉光刻 胶粘好支撑结构并去掉玻璃基底即形成有聚酰亚 胺支撑的金透射光栅.

4. 实验结果与讨论

衍射效率是评价光栅性能的重要指标.第2节 的分析表明位相光栅的占宽比和槽深将显著影响衍 射效率的分布.在一定的电镀条件下,电镀沉积的速 率一定,可以比较容易地控制槽深.为了对衍射效率 进行比较,我们分别制作了槽深 200 和 300 nm 的金 透射光栅,面积 20 nm × 5 nm.下面讨论占宽比的控 制和效率的检测.

4.1. 占宽比的控制

为了提高光栅的1级衍射效率,需要尽可能将 占宽比控制在 0.5 左右,即让槽和线的宽度尽可能 相等,然而 在全息光刻过程中 影响占宽比的因素 非常多,如光刻胶对曝光波长的敏感程度、前烘时间 及温度、曝光剂量、显影时间,显影液浓度等,除了这 些通常的因素之外 光刻胶光栅掩模的占宽比还受 到垂直驻波的影响,在全息曝光过程中,因为金导电 层的高反射率 反射光波与入射光波在光刻胶中形 成驻波 从而使光刻胶光栅线条侧壁呈波浪形状而 不再陡直,如图 6(a).为了使处于驻波最小处的光 刻胶获得足够的曝光量 需要加长曝光时间 但这样 做必然会使驻波最大处的光栅线条收缩 结果获得 的光刻胶光栅占宽比通常小于 0.5. 为了减小驻波 的影响 降低金导电层的反射率是一个有效的办法, 本文在保证良好导电性的同时尽可能降低金导电层 的厚度(5-12 nm)结果获得了侧壁陡直,占宽比约 为 0.45 的光刻胶光栅掩模(见图 (b)).图 7 是电镀 后去掉光刻胶的金光栅线条,占宽比大约为0.55, 光栅厚度约为 200 nm.

4.2. 位相光栅效率测量

位相光栅透射衍射效率的测量在国家同步辐射 的光谱辐射标准与计量实验站上完成,测量光路如 图 8 所示.实验使用的光谱范围是软 X 射线 5—12 nm 波段,小孔限制光斑尺寸,经过抑制高次谐波的

狭缝(宽 10 μm).在测量过程中,为了减小测量入射 光和衍射光的时间间隔,只测量衍射光的-2到+2 级的 5 个光斑,图 9 是入射波长 λ = 7.425 nm 的测 量曲线.可以看出在该波长,穿过光栅线条的入射光 受到光栅的位相调制和吸收作用之后,与直接从光 栅狭缝透过的入射光干涉叠加,结果 0 级减弱,±1 级被加强.各级次衍射效率等于对应各峰对横轴的 积分除以相应波长入射光强度曲线对横轴的积分.







图 9 周期为 1 µm ,占宽比为 0.55 槽深为 200 nm 的位相型金透 射光栅在 7.425 nm 处的衍射强度分布

图 10,11 是占宽比 0.55,槽深分别为 300 与 200 nm的金透射光栅的理论计算和实际测得的光栅 效率.从图 10 中可以看出,在测量波段,300 nm 厚的 金光栅线条完全不透明,即振幅型透射光栅,其 1 级 衍射效率理论值约为 10%.但由于支撑膜聚酰亚胺 层和金导电层对入射光波的吸收,虽然实际测量效 率的变化趋势和计算值吻合,但整体偏小,约为 9%.槽深为 200 nm 时,在 λ = 6.5—8 nm 波段,位相 作用使 1 级衍射效率高于 0 级,在 7.425 nm 处取得 最大值约 16%.2 级衍射效率约为 2%,正好说明光 栅线宽和槽宽不等.当然,效率的测量值中还包括了 入射光的漂移,槽深的测量误差,积分计算误差,以 及用于测量入射光的聚酰亚胺薄膜厚度与支撑位相 光栅的薄膜不相等等不可避免的因素带来的影响.



图 6 周期为 1 µm 的光刻胶光栅掩模

5.0kV

X15.00

lum



图 7 电镀去胶后的金光栅(槽深为 200 nm)

错滤片之后进入真空室,正入射到位相光栅上.均匀 取 20 个不同的波长,对每一个波长分别测量入射光 和各级衍射光的强度(功率).装有位相光栅的样品 台可以横向移动,当把光栅移出光路时,在光栅位置 放入一 300 nm 厚的聚酰亚胺薄膜,测量入射光强 度.只要放入的薄膜厚度与支撑位相光栅的薄膜厚 度相等,就可以使光栅效率的测量值接近真实值.当 把光栅移入光路后,入射光被光栅衍射成多个级次 (图 8 只画出±1和0级衍射光斑),用安装在光栅 后面的硅光二极管探测器旋转扫描测量各级光斑的 强度(功率).为了提高测量的准确度,探测器前加一



图 10 占宽比为 0.55 槽深为 300 nm 的振幅型金透射光栅衍射效率的理论(a)和实测(b)分布



图 11 占宽比为 0.55 槽深为 200 nm 的位相型金透射光栅衍射效率的理论 a 和实测 b 分布

5.结 论

在软 X 射线波段 ,为了获得比传统振幅型金透 射光栅高的透射衍射效率 ,本文介绍了位相型金透 射光栅的设计和制作方法.制作出了厚度大约为 200 nm,占宽比约为0.55,周期为1µm的透射光栅, 光栅线条由300 nm的聚酰亚胺支撑.在国家同步辐 射装置的软 X射线波段,光栅的衍射效率被测量, 结果表明+1级衍射效率大约为16%.

- [1] Schattenburg M L ,Canizares C R ,Dewey D ,Flanagan K A ,Hamnett M A ,Levine A M ,Lum K S K ,Manikkalingam R ,Market T H ,Smith H I 1991 Opt. Eng 30 1590
- [2] Savas T A Schattenburg M L ,Carter J M Smith H I 1996 J. Vac. Sci. Technol. B 14 4167
- [3] Xu X D , Hong Y L ,Huo T L Zhu X B Zhou H J ,Tao X M ,Fu S J 2001 Opt. Technol. 27 294 (in Chinese)[徐向东、洪义麟、霍同林、朱向冰、周红军、陶晓明、傅绍军 2001 光学技术 27 294]
- [4] Xu X D ,Hong Y L ,Fu S J 2003 Vac. Sci. Technol. 23 362 (in Chinese)[徐向东、洪义麟、傅绍军 2003 真空科学与技术 23 362]
- [5] Fu S J, Hong Y L, Tao X M, Su Y G, Tang Y J, Zheng Z J, Tang D Y 1992 Acta Opt. Sin. 12 825 (in Chinese)[傅绍军、洪义麟、陶 晓明、苏永刚、唐永建、郑志坚、唐道源 1992 光学学报 12 825]

- [6] Xu X D ,Hong Y L ,Fu S J 2004 *Physics* 33 340 (in Chinese)[徐 向东、洪义麟、傅绍军 2004 物理 33 340]
- [7] Ohmura Y, Oka T, Nakashima T 2006 App. Opts. 45 1713
- [8] Sadovnik L, Demichovskaya O, Chen R T 1991 Proc. SPIE. 1545 200
- [9] Yang J M, Ding Y N, Zheng Z J, Wang Y M, Zhang W H, Zhang J Y, Hong Y L, Xu X D, Fu S J 2003 High Power Laser & Particle Beams 15 69(in Chinese)[杨家敏、丁耀南、郑志坚、王耀梅、张 文海、张继彦、洪义麟、徐向东、付绍军 2003 强激光与粒子束 15 69]
- [10] Yang J M ,Ding Y N ,Sun K X ,Cheng J X ,Jiang S E ,Zheng Z J , Zhang W H 2000 Acta Phys. Sin. 49 747 (in Chinese)[杨家敏、 丁耀南、孙可煦、成金秀、江少恩、郑志坚、张文海 2000 物理 学报 49 747]

- [11] Yang J M ,Ding Y N ,Yi R Q ,Wang Y M Zhang W H Zheng Z J 2001 Acta Phys. Sin. 50 1723 (in Chinese)[杨家敏、丁耀南、易 荣清、王耀梅、张文海、郑志坚 2001 物理学报 50 1723]
- [12] Canizares C R , Davis J E , Dewey D , Flanagan K A , Galton E B , Huenemoerder D P , Ishibashi K , Markert T H , Marshall H L , McGuirk M Schattenburg M L Schulz N S Smith H I ,Wise M 2005 Publications of the Astronomical Society of the Pacific 117 1144
- [13] Canizares C R ,Schattenburg M L ,Smith H I 1985 Proc. SPIE 597 253
- [14] Yang J M ,Yi R Q Ma H L ,Chen Z L ,Wang H B Sun K X ,Wen S H Zheng Z J ,Tang D Y ,Cui M Q ,Li G ,Cui C W 1996 Acta Opt . Sin . 16 1631 (in Chinese) [杨家敏、易荣清、马洪良、陈正林、 王红斌、孙可煦、温树槐、郑志坚、唐道源、崔明启、黎 刚、崔

聪悟 1996 光学学报 16 1631]

- [15] Born M ,Wolf E 1999 Principles of Optics-7th Ed. (UK :Cambridge University Press)p446
- [16] Schnopper H W, Van Speybroeck L P, Delvaille J P, Epsein A, Kallne E, Bachrach R Z, Dijkstra J, Lantward L 1977 Appl. Opt. 16 1088
- [17] Hutley M C 1982 Diffraction Gratings (London : Academic Press) p95
- [18] Zhu X L ,Ma J ,Cao L F ,Yang J M ,Xie C Q ,Liu M ,Chen B Q ,Niu J B Zhang Q Z ,Jiang J ,Zhao M ,Ye T C 2007 *Chin . J . Semic .* 28 2006 (in Chinese)[朱效立、马 杰、曹磊峰、杨家敏、谢常青、刘 明、陈宝钦、牛洁斌、张庆钊、姜 骥、赵 珉、叶甜春 2007 半导体学报 28 2006]

Design and fabrication of gold transmission phase gratings for soft X-rays *

Qiu Ke-Qiang Xu Xiang-Dong[†] Liu Ying Hong Yi-Lin Fu Shao-Jun[‡]

(National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei 230029, China)

(Received 1 March 2008; revised manuscript received 18 April 2008)

Abstract

The diffraction efficiency of a gold transmission phase grating is simulated as a function of the depth of grooves and the duty cycle on the basis of the scalar diffraction theories. It is shown that the +1 order diffraction efficiency of a transmission phase grating with appropriate groove depth and duty cycle can be up to 21.9% of the incident light whereas it is no greater than 10% for a conventional amplitude-mode transmission grating. Transmission gratings with area of 20 mm × 5 mm ,period of 1 μ m ,duty cycle of 0.55 and 200 nm thick gold bars supported by a membrane of 300 nm thick polyimide have been fabricated by combining holographic lithography and electroplating. Its diffraction efficiency has been measured in national synchrotron radiation laboratory ,and the maximum efficiency in +1 order is about 16% at $\lambda = 7.425$ nm.

Keywords: transmission phase grating , holographic lithography , electroplating **PACC**: 4240E , 4280F , 0765

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50375149, 10776030).

[†] Corresponding author. E-mail:xxd@ustc.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail : sjfu@ustc.edu.cn